## 銅錯体を用いた低線量 X 線照射による DNA 切断

(青山学院大1) ○明正航典1・西原達哉1・田邉一仁1

DNA cleavage by low-dose X-ray irradiation using copper complexes (\(^1School\) of Aoyama Gakuin University)\(\) Kousuke Meisho\(^1\), Tatsuya Nishihara\(^1\), Kazuhito Tanabe\(^1\)

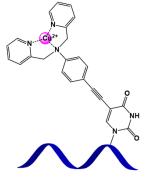
In recent years, various metal complexes have attracted attention, because they accelerate DNA cleavage. They are expected to be used as anticancer and antiviral agents. However, the non-specific cleavage of nucleic acid by metal complexes are still issue to be solved.

In this study, we focused on the fact that monovalent copper complexes show high DNA cleavage activity, while divalent copper complexes do not. Taking advantage of this property of copper complexes, we designed a system in which DNA cleavage occurs only under X-irradiation conditions, which reduce Cu(II) to form Cu(I). We designed an artificial oligodeoxynucleotides (ODNs) with pyridyl ligands for copper ion on thymine base in order to construct a system. The ODNs were designed so that Cu(I) generates at a specific site on the DNA strand upon X-irradiation. We will report the synthesis and radiation reaction of the ODNs.

## Keywords: DNA cleavage; X-ray; copper complex

近年、様々な金属錯体が核酸切断を促すことが明らかにされ、抗がん剤や抗ウイルス剤としての活用が期待されている。しかし、一方で金属錯体の反応性を制御することは一般に困難であり、金属錯体が非特異的な核酸損傷を促すことが問題となっていた。

このような背景の下、我々は 1 価の銅錯体が高い DNA 切断活性を示す一方、2 価の銅錯体が切断活性を示さない事実を活用し、X 線照射下でのみ金属錯体の DNA 切断が生じるシステムを設計した(Figure 1)。本研究では、DNA 鎖の塩基部に Cu(II)の配位子を導入し Cu(I)が DNA 鎖の特定部位に、X 線還元によって発生するように設計した。



**Figure 1.** Oligonucleotides bearing Cu(II) complex

塩基部への配位子の導入は Schemel に従って行った。4-iodoaniline を出発物質とし、 薗頭反応を経て、アセチレン誘導体2を得た。続いて、ヨードウリジン誘導体とカッ プリングし、アミノフェニル基を持つウリジン誘導体4を得た。保護基を除去した後、 得られたジオール5を DMTr 化し、化合物6を得た。現在、DNA への導入を試みて おり、DNA 切断実験と併せて報告する。

Scheme1. Synthesis of artificial oligonucleotides